

【19】中華民國

【12】發明公開公報 (A)

【11】公開編號：201923449

申請實體審查：有

【43】公開日：中華民國 108 (2019) 年 06 月 16 日

【51】Int. Cl. :

G03F1/72 (2012.01)

G03F1/42 (2012.01)

G03F1/76 (2012.01)

G03F9/00 (2006.01)

【54】發明名稱：圖案化裝置、用於圖案化裝置之製造方法、用於圖案化倍縮光罩之系統、
檢測工具之校準方法及微影設備

PATTERNING DEVICE, MANUFACTURING METHOD FOR A
PATTERNING DEVICE, SYSTEM FOR PATTERNING A RETICLE,
CALIBRATION METHOD OF AN INSPECTION TOOL, AND
LITHOGRAPHIC APPARATUS

【21】申請案號：107131678

【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 09 月 10 日

【30】優先權：2017/09/26

歐洲專利局

EP17193045

2018/06/25

歐洲專利局

EP18179618

【72】發明人：何根邦 湯瑪斯 里歐 瑪利亞 (NL) HOOGENBOOM, THOMAS LEO
MARIA ; 克瑞馬 雨果 奧格斯提納斯 約瑟夫 (NL) CRAMER, HUGO
AUGUSTINUS JOSEPH

【71】申請人：荷蘭商 A S M L 荷蘭公司
荷蘭

ASML NETHERLANDS B.V.

【74】代理人：林嘉興

【57】發明摘要：

一種用於一檢測工具之校準方法，該校準方法包含藉由以下操作來判定該檢測工具之一校準參數： - 接收與一或多個基板相關聯之資料，該一或多個基板包含複數個目標部分，各別複數個圖案被提供至該複數個目標部分上，其中該複數個圖案係藉由特徵在於至少一個程序參數相對於一標稱值之一已知變異的一半導體製造程序形成； - 基於接收到之資料而判定該複數個圖案中之每一者之一特性；及 - 基於經量測特性及已知程序參數變異而判定該檢測工具之該校準參數。

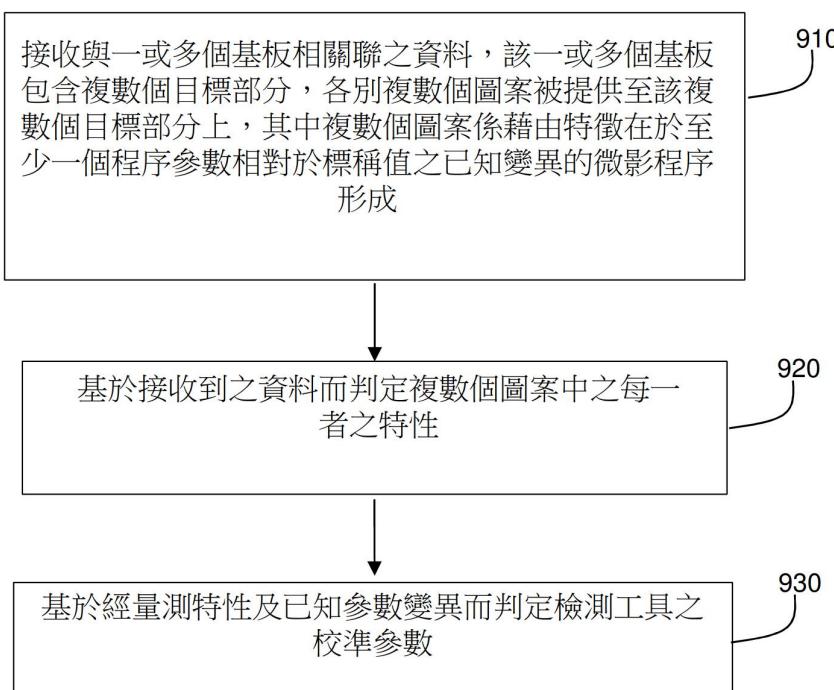
指定代表圖：

符號簡單說明：

910 · · · 步驟

920 · · · 步驟

930 · · · 步驟



【圖9】